

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n005rki8
NO_DOC_EXT:	2023-181164
SOFTWARE_VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	alessandra.brocca@ifn.cnr.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F03
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Avviso di aggiudicazione di appalto**Risultati della procedura di appalto****Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DEL CNR

Numero di identificazione nazionale: 80054330586

Indirizzo postale: Via Sommarive 18

Città: TRENTO

Codice NUTS: ITH20 Trento

Codice postale: 38128

Paese: Italia

Persona di contatto: ALESSANDRA BROCCA

E-mail: alessandra.brocca@ifn.cnr.it

Tel.: +39 0223996281

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.cnr.it

Indirizzo del profilo di committente: www.cnr.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: ente pubblico nazionale

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: ricerca scientifica

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

sistema per la rimozione di materiali in plasma della tipologia RIE Reactive Ion Etching

Numero di riferimento: A01C1D6834

II.1.2) Codice CPV principale

38970000 Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

GARA DESERTA PER MANCANZA DI OFFERTE

fornitura, l'installazione e la messa in funzione di un sistema di Plasma Etching per la rimozione in plasma di Ossidi, Ossi-nitruri e Nitruri di silicio, Poli-silicio, drogato e non drogato su lotti di produzione da 25 wafer di substrati da 150 mm, predisposti per trattare substrati da 200 mm. L'apparecchiatura sarà collocata in modalità through the wall presso la cleanroom DETECTOR della Micro-nano Characterization and Fabrication Facility, Fondazione Bruno Kessler di Trento, in via Sommarive 18. Lo spazio disponibile massimo per l'apparecchiatura è di 1.35 m (larghezza), 2.5 m (profondità), 2.4 m (altezza). Il Concorrente dovrà indicare

l'ingombro dell'apparecchiatura, incluse le aree di servizio (clearance) ottimizzando la disposizione all'interno della stessa. Saranno escluse le apparecchiature il cui ingombro eccede l'area disponibile.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH20 Trento

Luogo principale di esecuzione:

CNR-IFN TRENTO laboratorio Cleanroom CR D presso la Fondazione Bruno Kessler, Via Sommarive 18, 38123 Povo – Trento

modalità di collocazione della strumentazione: through the wall

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

GARA DESERTA - NESSUNA OFFERTA PRESENTATA

fornitura, l'installazione e la messa in funzione di un sistema di Plasma Etching per la rimozione in plasma di Ossidi, Ossi-nitruri e Nitruri di silicio, Poli-silicio, drogato e non drogato su lotti di produzione da 25 wafer di substrati da 150 mm, predisposti per trattare substrati da 200 mm. L'apparecchiatura sarà collocata in modalità through the wall presso la cleanroom DETECTOR della Micro-nano Characterization and Fabrication Facility, Fondazione Bruno Kessler di Trento, in via Sommarive 18. Lo spazio disponibile massimo per l'apparecchiatura è di 1.35 m (larghezza), 2.5 m (profondità), 2.4 m (altezza). Il Concorrente dovrà indicare l'ingombro dell'apparecchiatura, incluse le aree di servizio (clearance) ottimizzando la disposizione all'interno della stessa. Saranno escluse le apparecchiature il cui ingombro eccede l'area disponibile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Criterio di qualità - Nome: pregio tecnico / Ponderazione: 70

Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

(PNRR) MISSIONE 4 "Istruzione e Ricerca" COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa" INVESTIMENTO 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" PROGETTO NFFA-DI "NANO FOUNDRIES AND FINE ANALYSIS - DIGITAL INFRASTRUCTURE" CUP B53C22004310006

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Numero dell'avviso nella GU S: [2023/S 201-629715](#)

IV.2.8) **Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione**

IV.2.9) **Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione**

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

sistema per la rimozione di materiali in plasma della tipologia RIE Reactive Ion Etching

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) **Informazioni relative alla non aggiudicazione**

L'appalto/il lotto non è aggiudicato

Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) **Informazioni complementari:**

LA GARA E' ANDATA DESERTA IN QUANTO NON SONO PERVENUTE OFFERTE

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Indirizzo postale: VIA FLAMINIA, 189

Città: ROMA

Codice postale: 00196

Paese: Italia

E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tel.: +39 06328721

Fax: +39 32872315

Indirizzo Internet: www.giustiziaammnistrativa.it

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

10/11/2023